

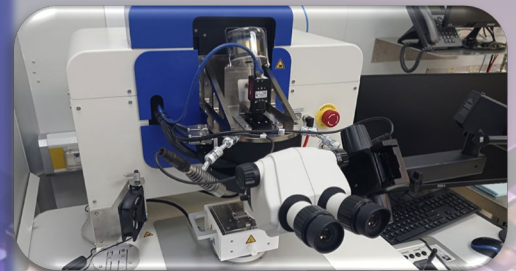
Técnicas de litografía en Semiconductores

Microcredencial 6 ECTS (30h aula + 30h laboratorio)

CÁTEDRA UPM – INDRA en MICROELECTRÓNICA

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

1. Introducción a la litografía
 - i. Tipos de litografía
 - ii. Tipos de Resinas
 - iii. Ataques y gases específicos para los mismos
2. Litografía óptica
3. Litografía por haz de electrones (e-beam lithography, EBL)
4. Preparación de máscaras para litografía óptica
5. NanoFrazor Lithography (NFL)
6. Software de diseño de máscaras.
7. Software de cálculo de dosis basado en simulaciones Montecarlo y diseño de campos de escritura: BEAMER y TRACER



**MATRÍCULA 100%
GRATUITA,
FINANCIADO POR
CÁTEDRA
UPM-INDRA**

 Del 10/03/2025 al 02/07/2025 (L y X de 17:00h a 19:00h)

 PRESENCIAL. Laboratorios del ISOM y aulas de la ETSI Telecomunicación

 comunidad.microelectronica@upm.es

PREINSCRÍBETE